



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 044133181
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 375274
आवेदन सं. / Application No. : 201841028532
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 30/07/2018
पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT Madras)
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : Dr. Prahallad Padhan

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित APPARATUS AND METHOD DEVELOPED FOR THE DEPOSITION OF COMPLEX OXIDE THIN FILMS INSIDE THE WATER COOLED PORT OF SPUTTERNG CHAMBER USING PULSED PLASMA नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 30th day of July 2018 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled APPARATUS AND METHOD DEVELOPED FOR THE DEPOSITION OF COMPLEX OXIDE THIN FILMS INSIDE THE WATER COOLED PORT OF SPUTTERNG CHAMBER USING PULSED PLASMA as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 30th day of July 2018 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 25/08/2021
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 30th day of July 2020 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 30th day of July 2020 and on the same day in every year thereafter.